

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第6部門第4区分

【発行日】平成27年11月19日(2015.11.19)

【公開番号】特開2014-175049(P2014-175049A)

【公開日】平成26年9月22日(2014.9.22)

【年通号数】公開・登録公報2014-051

【出願番号】特願2014-47701(P2014-47701)

【国際特許分類】

G 11 B 5/39 (2006.01)

【F I】

G 11 B 5/39

【手続補正書】

【提出日】平成27年10月1日(2015.10.1)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

リーダースタックにわたって埋め戻し材の層を蒸着することと、

前記埋め戻し材を蒸着した後、前記埋め戻し材の層の上部に化学機械的研磨停止層を蒸着することと、

前記化学機械的研磨停止層を蒸着した後、前記化学機械的研磨停止層の上に犠牲層を蒸着することと、

を含む方法。

【請求項2】

前記リーダースタックの上に蒸着されたフォトレジスト層の部分を暴露することをさらに含む、請求項1に記載の方法。

【請求項3】

前記暴露部分を介して前記フォトレジストを除去することをさらに含む、請求項2に記載の方法。

【請求項4】

リーダースタックと、

前記リーダースタックの隣および上部の埋め戻し層と、

前記埋め戻し層の上の化学機械的研磨停止層と、

前記化学機械的研磨停止層の上の犠牲層と、

を備える装置。

【請求項5】

前記リーダースタックの上に配置されたフォトレジスト層をさらに備え、

前記埋め戻し層が、前記フォトレジスト層を覆う、請求項4に記載の装置。